

# Éditorial

---

**Laurence LABAT**

---

Responsable du Groupe de Travail « Métaux » dans la commission « Risques toxicologiques » de la SFTA

Introduite au début des années 80, la spectrométrie d'émission en plasma induit couplée à la spectrométrie de masse (ICP-MS) est devenue une technologie incontournable pour les laboratoires spécialisés dans le dosage des métaux. Progressivement, l'ICP-MS s'implante dans la plupart de nos laboratoires et on lui trouve rapidement de nombreux avantages : son caractère multi-élémentaire fait partie des intérêts essentiels de cette méthodologie, mais on lui associe également des critères de qualité en terme de sensibilité et de rapidité d'analyse.

Lors de la journée spéciale « Applications en ICP-MS » organisée par la SFTA en partenariat avec les constructeurs le 2 février 2007 à Paris, nous avons essayé de vous proposer un programme diversifié, faisant appel à des spécialistes de l'ICP-MS et également à des utilisateurs, pour la plupart plus récents, dans les différents domaines de la toxicologie. Votre participation à cette journée nous a montré l'intérêt que vous portiez à cette méthode de dosage multi-élémentaire des métaux et métalloïdes et a conforté l'idée que l'organisation d'une telle journée était très importante.

Une nouvelle fois dans les *Annales de Toxicologie Analytique*, un numéro entier est consacré à une technologie récente et en plein essor (en 2005, un numéro spécial sur les applications en LC-MS/MS avait été publié). Je tiens à remercier tous les auteurs qui ont bien voulu contribuer à l'élaboration de ce numéro en y développant quelques aspects de leur activité.

Nous espérons que ce numéro spécial ICP-MS participera comme cette journée à l'amélioration de nos connaissances sur le sujet.

**Note du rédacteur en chef :**

*La plupart des articles ont été demandés spécialement pour la Journée « Applications en ICP-MS » par le comité de rédaction des Annales de Toxicologie Analytique. Les opinions des auteurs n'engagent qu'eux-mêmes et la rédaction n'est pas responsable des affirmations et argumentations développées dans ce numéro spécial consacré à l'ICP-MS.*

Marc DEVEAUX, rédacteur en chef